

DIN 50455-2:1999-11 (D)

Prüfung von Materialien für die Halbleitertechnologie - Verfahren zur Charakterisierung von Fotolacken - Teil 2: Bestimmung der Lichtempfindlichkeit von Positiv-Fotolacken

Inhalt		Seite
Vorwort	1
1	Anwendungsbereich	1
2	Normative Verweisungen	1
3	Kurzbeschreibung des Verfahrens	1
4	Formelzeichen und Einheiten	1
5	Definitionen	2
6	Geräte und Materialien	2
7	Durchführung	3
7.1	Allgemeines	3
7.2	Auftragung des Fotolackes	3
7.3	Belichtung	3
7.4	Entwicklung	3
8	Auswertung	3
9	Präzision des Verfahrens	3
10	Prüfbericht	4